



H₂O/O₂ Free Gas Purifier

水・酸素フリーガス精製装置



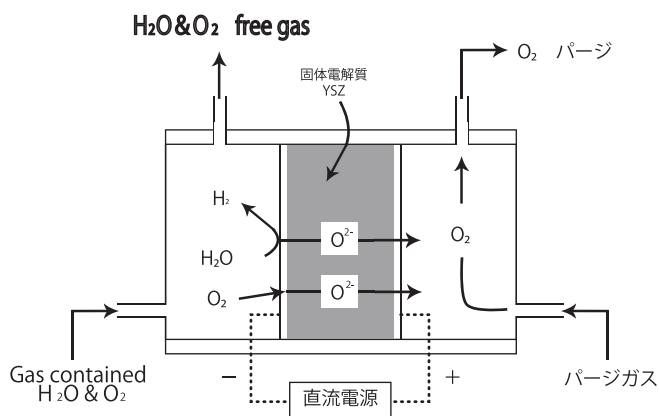
SiWOF-2000

装置概要

水・酸素フリーガス精製装置 (SiWOF-2000) は、酸素イオン導伝体を応用した、ニュータイプのガスピュリファイアーです。従来の乾燥剤方式、コールドラップ方式、フィルタ方式などの水分除去装置は、連続運転が困難でしたが、本装置では原理的に除湿量、脱酸素量に制限がないため、長期間(約1年)の連続運転が可能です。

原理

酸素イオン導伝体 (Yttria Stabilized Zirconia) を用いた電気的な水分分解除去法、及び酸素除去機能を利用。



特徴

- 酸素フリー(1×10⁻²⁰atmO₂以下)低露点(DP-90℃以下)精製ガスを長期間連続的に供給できます。
- 不活性ガス(N₂,Ar,など)水素ガスの精製ができます。
- 長期連続運転が可能です。

(注：水素は検知器オプションが必要です。)

仕様

処理ガス流量：2.0 S L M (0.2m³/h)
 処理ガス損：不活性ガス(He,Ar,N₂)及び水素ガス
 処理ガス圧力：0～100kPa(ゲージ圧)
 供給ガス純度：工業用ガス相当(10ppmvH₂O,O₂以下)
 精製ガス純度：H₂O…100ppbv(DP-90℃)以下、O₂…1×10⁻²⁰atm以下
 寸法：W270×D250×H1200
 重量：約35kg
 電源：AC100V/1.5kVA
 据付：壁掛け式
 (オプションにて専用キャスター付架台準備)



エスティーラボ株式会社

URL <http://www.stlab.co.jp> E-mail info@stlab.co.jp
 〒312-0042 茨城県ひたちなか市東大島2丁目11-24 アシストひたちなかビル
 TEL:029(219)5675 FAX:029(219)5676